



高密度 SiO₂ 产品信息

高密度 SiO₂ 是一种低折射率的蒸发材料，是经过高真空脱气制成。具有很多优异的光学性能，比如有较宽的透光范围，能在紫外区、可见光区和红外区域有效透过；具有良好的化学稳定性，机械性能极为牢固；能和多数氧化物匹配成膜，而且可以采用很高的蒸发速率镀膜，膜层具有很高的硬度，是一种常规的低折射率蒸发镀膜材料。

材料特性

熔点：	约 1700℃
蒸发温度：	1800 – 2200℃
折射率：	1.46 (λ = 550nm)
透光范围：	200nm—2000nm
外观：	无色透明颗粒
粒度分级：	1 – 3mm, 2 – 4mm, 3 – 5mm

蒸发条件

蒸发速率：	0.4–0.8nm/sec
蒸镀充氧压力：	8.0E-3Pa--1.4E-2Pa.
基板温度：	280℃
材料密度设定：	2.20g/cc
Z – Ratio：	1.0

蒸发结果

日本电子枪： 型号 JEBG – 102U

水冷 Cu 坩锅： 环形坩锅

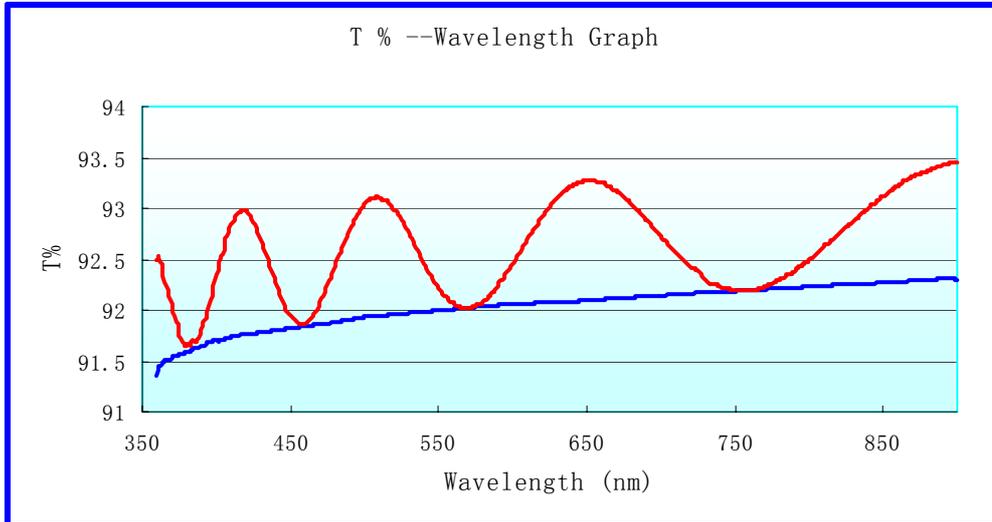
排气系统： RP+MBP+DP

蒸发材料 SiO₂ 单层膜曲线，透过 (T%) 与波长 (Wavelength) 之间的关系图

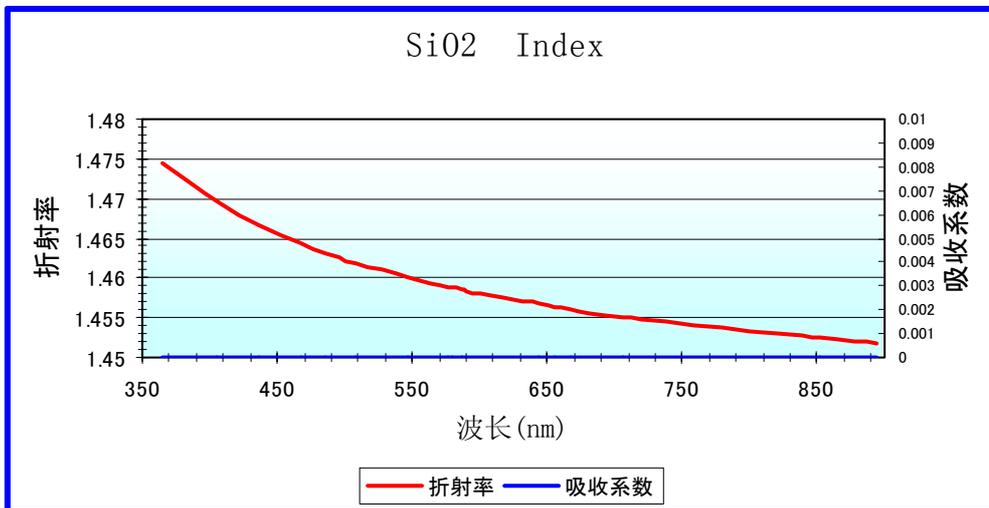
光学厚度 6 Peak, 监控波长 550nm.

分光仪器: HITACHI U4100

基板材质: K9 (N=1.52)



蒸发材料 SiO₂ 随着充氧量, 蒸发速率等参数的不同, 其折射率有些变化。如下得到的图线是该材料在不同波长条件下的折射率:



以上是对高密度 SiO₂ 的概述, 如有疑问, 敬请来电咨询。期待您的宝贵意见。谢谢您的支持与合作。